(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許 公報 (A)

昭58—16094

MInt. Cl.3 C 25 D 5/10 B 32 B 15/04 識別記号

庁内整理番号 6575-4K 6766-4F

母公開 昭和58年(1983)1月29日 発明の数 4 審査請求 未請求

(全 6 頁)

②金属基質上に歪許容性セラミック熱障壁被覆 を施す方法

@特

願 昭57—114757

@出

昭57(1982)6月30日

優先権主張 ②1981年6月30日③米国(US)

@278938

@発

明 者 デユアンヌ・ルイス・ラツクル アメリカ合衆国アリゾナ州メサ ・イースト・カエル・サークル

2044

@発 明 者 コンラッド・マーチン・パナス アメリカ合衆国コネチカツト州 ボルトン・ヴオルピ・ロード56

伽発 明 者 フランシス・サルヴアトア・ギ ヤラツソ

> アメリカ合衆国コネチカツト州 マンチエスター・グリーン・マ ナー・ロード13

の出 願 人 ユナイテッド・テクノロジーズ ・コーポレイション

> アメリカ合衆国コネチカツト州 ハートフオード・フイナンシヤ

ル・プラザ1

四代 理 人 弁理士 明石昌毅

1. 発明の名称

金属基質上に歪許容性セラミック熱薄壁被確を

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 金属装質上に歪許容性セラミック熱障壁被 覆を施す方法にして、
- a. 基質の表面に調告な付着性のセラミック被覆 を着抜する工程と、
- b. セラミックを大きく乗発させることなく且金 民基質を溶融させることなくセラミックの表面を 辞載させる条件にてセラミック被覆の表面を加熱 する工程と、
- C、根数されたセラミックを裏倒させる工程と、 を含み、前記前数されたセラミックの裏因時にセ ラミック被覆の溶験された部分に割れ目のネット ワークが形成され、前記割れ目は前記セラミック 被履の表面に対し実質的に垂直に配向されている ことを特徴とする方法。
- (2) 金属基質上に歪許容性セラミック熱等壁被

履を値す方法にして、

- 差費の表面に獲密な付着性のセラミック被覆 を兼数する工程と、
- b. セラミックを大きく蒸発させることなく且金 魔巣艦を拍験させることなくセラミックの表面を 倍融させる条件にてセラミック装置の表面を加熱
- c、溶風されたセラミックを裏固させる工程と、
- d、部分的に割れ目を形成された被覆された基質 を周期的に加熱し冷却する工程と、
- を含み、前記溶融されたセラミックの裏因時にセ ラミック被覆の倍載された部分に割れ目のネット ワークが形成され、前記割れ目は前記セラミック **袖種の表面に対し実質的に垂直に配向されており、** 前記展開的加熱及び冷却の工程に於て前記割れ目 が差質へ向けて内方へ伝援することを特徴とする 方法。
- (3) 金属基質上に歪許容性セラミック熱障壁被 程を施す方法にして、
- 8. 基質の表面に金属器ポンド被覆を着抜する工

特開昭58-16094(2)

程と、

□ · 基質の表面に領密な付着性のセラミック液態 を着装する工程と、

 セラミックを大きく森発させることなく且金 震碁質を容融させることなくセラミックの表面を 溶融させる条件にてセラミック被雇の表面を加熱 する工程と、

(. 密融されたセラミックを裏面させる工程と、を含み、前記溶晶されたセラミックの裏面時にセラミック被覆の密融された部分に割れ目のネットワークが形成され、前記割れ目は前記セラミック該種の表面に対し支質的に垂直に配向されていることを特徴とする方法。

(4)金属基質上に歪許容性セラミック熱障壁被 腹を施す方法にして、

8. 基質の表面に金属製ポンド被理を着装する工程と、

b. 基質の表面に調整な付着性のセラミック被理を着致する工程と、

0. セラミックを大きく葉発させることなく且金

興 基質を溶 動させることなくセラミックの 表面を 溶 動させる条件に てセラミック 被関の表面を加熱 する工程と、

4. 存載されたセラミックを裏固させる工程と、

6. 部分的に割れ目を形成された被覆された装置 を周期的に加熱し冷却する工程と、

を含み、前配容融されたセラミックの質問時にセラミック被極の容融された部分に割れ目のネットワークが形成され、前記割れ目は前配セラミック被覆の表面に対し変質的に垂直に配向されており、前記周期的加熱及び冷却の工程に放て前配割れ目が差異へ向けて内方へ伝援することを特徴とする方法。

3. 発明の詳載な説明

本発明は金属基質上に歪許容性セラミック被理を施す方法に係る。

当技術分野に放ては、長年に互りセラミックの 特性と金属の特性とを組合わせる努力が払われている。例えば、セラミックの兼特性と金属の物性 とを組合わせるべく、高温度に放て使用される金

真物品に保護セラミック被種を施す多くの試みが なされている。

これまで解決されていない主要な問題は、金属とセラミックとの競影張係数が実質的に異なることにより、冷酷サイクルを受ける条件下に決てセラミック被理が確認するということである。

本発明は金質を質上にセグメントに分割されたセラミック被種を形成する方法を提供することである。本提明に決ては、金属製の物品はその外面に付着性のセラミック被種を有しているものと仮定される。基質とセラミック被種との間にはセラ

ミック被覆の付着を補助すべく、ポンド被雇若しくは介在費が介積されることが好ましい。 セラミック表面層は強力な絶滅を使用して割れ目を形成されることによりセグメントに分割される。 セラミック被雇の自由面は急激に溶動され、その要因時に割れ目が発生する。

以下に転付の図を参照しつつ、本発明を実施例でついて発観に説明する。

本発明にとって必獲の予告工程は、製密且連続的な付着性のセラミック被互にて被狙された越質

を用意することである。今日までプラズマスプレ 一法によりセラミック被雇の意味が行なわれてい るが、スラリー被雇法、スパッタリング法の如き 他の方法も使用されてよいことは明らかである。 セラミック被覆は基質に付着したものでなければ ならず、その場合の最良の付着性はセラミック被 覆と基質との間にポンド被覆を介装することによ って待られる。ボンド被覆としては簡々の被覆が 使用されてよい。例えばクロムの組成能曲が約 2 O ~ 4 5 % であるM C r 被覆、クロムの組成範囲 が約15~45%でありアルミニウムの組成範囲 が約7~15%であるM Cr A I 被機、上記の組 成以外の組成を有するM.C.P.被艦、コパルトの組 成範囲が約15~45%でありアルミニウムの観 成範囲が約7~20%でありイットリウムの組成 範囲が約り、1~5%であるMCFAIY執環、 クロムの組成範囲が約15~45%でありアルミ ニウムの組成範囲が約7~15%でありハフニウ ムの組成範囲が約り、5~7%であるMCr Al H!被覆などであってよい。尚これらのポンド被

ボンド被目は、もしそれが使用される場合には、 物理的磁想法やプラズマスプレー法の処き種々の 方法により着枝されてよい。軽惰性の製点からは プラズマスプレー法が好ましい。ボンド被痕の厚 さは例えばり、り25~2.54mmの如く、広い 範囲のものであってよい。

上述の如く、セラミック被覆は鞭告なものでな ければならず、プラズマスプレー法の場合には、 セラミック被覆を裏密にすることはアラズマスプ レーのパラメータを制御することによって達成さ れる。一般に興密な被機は、粒子寸法の範囲が概 定された無服なセラミック粉末を追常の入力電力 よりも高い入力電力との組合せにて使用すること により得られる。 Plasmadyne SG100ガンを 使用してスプレーされる安定化されたジルコンの 組合には、全動来の20%以下の動来がり、05 5 ■■以下であり且全粉末の10%以下の粉末が0. 03.7 88以下である平均0.044 880 粉末とな るよう篩にかけられた粉末を使用すれば、最も良 好な筋果が得られることが無った。またこの場合、 5 0 ポルト、8 0 0 アンペアの入力電力が使用さ れ、スプレーガンから版本(基質)までの距離は 約78.2mm あった。セラミック被狂の着鞋は 5 %のヘリウムを含むアルゴンキャリヤガスを使

特開昭58-16094 (4)

用して空気中にて行なわれ、基質は316で以下の温度にまで冷却された。セラミック被曝の厚さは企図する用途に応じて広い範囲のものであってよい。被咽の厚さは0.025~8.35mm若しくはそれ以上であることが有用であるものと考えられる。

本発明の目的で、稠密なセラミック被匿は、金 無相報学的方法により引して、約15%により引きなして、約15%により引きませる。 ものである。特に本発明に分割され、複響・ 品が表つかのセクションに分割され、複響・ 品が表つかのセクションに分割され、を がまれたを抜け出させることのない研密を 使用して研密され、しかる後 Quantimet (を 板側) 有孔度の標定を 板板の のである。 を のでは、 のでは、 を のでは、 のでは、 を のでは、 のでは、 のいのでは、 のいでは、 のでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、 のいでは、

上述の如き明らかに観密であるセラミック被覆 も、本発明の方法により以下の如くセグメントに 分割されなければ、過酷な冷熱サイクルを受ける 条件下に於ては損傷を生じる。被痕をセグメント に分割することにより、その下層としての基質の 野研を許し且セラミック被復内の圧縮応力をセラミック被覆の類似を生じる値以下のレベルに制限 する割れ目が形成される。

セラミック被覆は、強力な愚匱を用いてセラミ ック被理を部分的に搭載させ、しかる侵容器され たセラミックを裏固させることにより、セグメン 小に分割される。溶離されたセラミックが原因す る道程に放て発生する収縮により、セラミック被 程をセグメントに分割する効果が発生する。本発 明による方法に放ては強力な熟度が必要とされる。 今日まで行なわれた実験的研究に放ては連続彼供 酸ガスレーザを使用することが含まれているが、 **電子ピーム装置や水素が燃焼する際の火炎の如き 開放火炎などの他の熱類も使用されてよい。約1.** 5 5 × 1 0 ª watt/ dのエネルキ密度が必要であ るものと考えられる。しかし必要な条件は、差質 又はポンド被理を溶脱させることなくセラミック 被覆をその厚さ方向に部分的に辞載させるエネル 4 密度とドエルタイぷとの粗合せとして遺食に決 定される。グルコニアは約2093℃にて容置し、

典型的な基質及びポンド被覆の材料は約1316 でにて容敵するので、基質を容赦させることなく セラミック被覆を搭載させるためには迅速な入憩 が必要である。他方、エネルギ密度が高速ぎると セラミックが煮発し、セラミックの差発はセラミ ック材料を投費することとなり、またそのことを 制御することが困難であるので、セラミックが実 質的に蒸発することは回避されなければならない。 従ってセラミックの実質的な義勇を惹起すること なくセラミック装置の厚さの10~90%に当る 促さにまでセラミック被覆を溶融させる条件が使 用されることが好ましい。溶血された部分がセラ ミック被覆の序さの約10%以下である場合には、 所望の割れ目ネットワークは完全には発生しない。 またセラミック被威がその厚さの約90%以上に 互って辞聴されると、基質及び/又はポンド被信 をも溶散してしまう可能性が高くなってしまう。 セラミック被雇の溶融が行なわれると、熱が基質 に伝達されまた大気に伝達される結果として必然 的に容融されたセラミックの最固が発生する。セ

ラミックが容置されているときには、その容置さ れたセラミックは基質と応力が平衡した状態にあ る。しかし凝固時には推議されたセラミックは体 積が大きく緩かし、その結果その容置され裏因す る部分に引張り応力が発生される。この引張り応 力はゼラミックの強度以上のものであり、セラミ ック被理に割れ目を発生する。割れ目はセラミッ ク装置の凝固した部分を貫通して延在し、場合に よっては凝固した部分を越えて延在しており、こ れらの割れ目は割れ目ネットワークを形成し、セ ラミック被覆を一般に8.25■■程度の大きさで あるセグメントに分割する。この割れ目ネットワ ークはセラミック被覆内に実質的な量の歪許容性 を与えるのに必要とされるものである。例れ目の 提さは実質的に容融された部分の提さに答しいが、 セラミックの脆性のために、割れ目はポンド被覆 の基質との界面に到達するまで容易に内方へ成長 する。かかる成長は、被職された部材の使用中に それが受ける治熱サイクルにより又は被雇された

部材の使用に先立って割れ目を成長させるために

特開昭58- 16094 (5)

故意に行なわれる冷熱サイクルにより意起こされる問題的な応力にセラミック被理が聞されたときに発生する。

成る条件の下では、セラミック被撻の表面を笞 融させる工程前及びその工程中に数据された基質 を予熱することが必要であることが解っている。 かくして被覆された装御を予熱することにより、 セラミック放便の表面特面時にセラミック被覆の 製盤が生じることを有効に防止する初期応力状態。 が形成される。表面榕蔵工程中には、セラミック 無は加熱され、セラミック被覆が実際に溶融する 前にセラミック被雇が圧縮応力により基質より到 誰する程度にまで製造する。被覆された数品全体 を予覧することにより、金属基質はセラミック被 確よりも大きな比率にて鬱蛋し、これによりセラ」 ミック被理が初期引張り応力状態にもたらされる。 表面溶散工程時には、セラミック被覆の影張は破 権的な圧縮応力を発生するほどには至らない。予 施工程は金属基質がセラミック被職の厚さに比し て実質的な新面積を有する場合に必要である。シ

第1因及び第2因に本発明による方法の結果が示されている。第1因及び第2因はレーザによる 表面容融機に於けるセラミック被概を施されたニッケル結實の断衝を100倍にて示す写真である。 セラミック材料は20重量%のイットリウムを振 加することにより安定化されたジルコニアを含ん でおり、プラズマスプレー法により基質に着数さ

れたものである。被腹の初期厚さは約250μで あった。レーザ光線はそれが約66、♡■■の長輪 と2544の短軸とを有する楕円形衡面を有する よう調整された。入力は5 kWであった。第1回 はレーザ光線が254cm/min の走査速度にてセ ラミック被収の表面に走査された後に投ける結果 を示している。かかる処理の結果セラミック層の 厚さの約半分が溶融され、所築の割れ目構造が形 成された。割れ目はセラミック被覆の存置された 部分を黄通して延在しており、このことを第1因 に放てセラミック被覆の溶血された部分に見るこ とができる。第2回はレーザ光線の走査速度が1 2 7 cm/min に低減された点を動き第1回に示さ れたものと同一の条件にて行なわれた処理の結果 を示している。この処理の結果啓園された部分の 深さが実質的に増大しており、また割れ目が溶散 された部分の探さにまで延在していることが解る。

上述の如く、表面相談により形成された割れ目を冷酷サイクルによってセラミック被覆内に更に成長させることができる。例えば割れ目を生じて

いる被収された基質を538℃の値度に加熱し、 次いでそれを水にて焼入れすることにより基質又 はポンド被種へ向けて割れ目を成長させることが できる。

以上に於ては本発明を特定の実施例について詳細に説明したが、本発明はかかる実施例に設定されるものではなく、本発明の範囲内にて程々の実施例が可能であることは当業者にとって明らかであるう。

持開昭58- 16094 (6)

100 X

第1 図はレーザ光糖が25 4 cm/min の走査速度にてセラミック被覆の表面に走査されることによりセグメントに分割されたセラミック被覆の新面を100倍にて示す顕微鏡写真である。

4. 図面の簡単な説明

第2回はレーザ光線が1270m/Bin の走査速度にてセラミック被覆の表面に走査されることによりセグメントに分割されたセラミック被覆の断面を100倍にて示す順数数写真である。

特許出版人 ユナイテッド・テクノロジーズ・

代理人 弁理士 明石昌版

BEST AVAILABLE COPY

F16. 2

100 X .

